PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-019345

(43)Date of publication of application: 21.01.2000

(51)Int.CI.

G02B 6/30 G02B 6/36 G02B 6/42

(21)Application number: 10-188374

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

03.07.1998

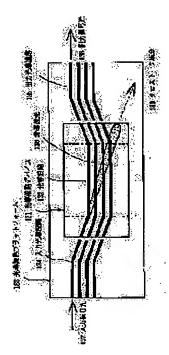
(72)Inventor: KATO TOMOAKI

(54) OPTICAL INTEGRATED MODULE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate the effect that optical switching performance is affected by a non-waveguided beam caused by optical waveguide discontinuity substantially inevitable in hybrid optical integration.

SOLUTION: This optical integrated module is constituted so that tilted optical waveguide parts of incident/emission both end surfaces of an optical waveguide 132 of an optical waveguide device 131 are formed to be curved toward the same side for a straight line of an optical waveguide platform 133 in the longitudinal direction, and further, the input optical waveguide 134 and the output waveguide 135 of the optical waveguide platform 133 are formed to be curved toward the same direction also answering to the curved of the optical waveguide 132 of the optical waveguide device 131. The non-waveguided beam caused at the time of being waveguided from the optical waveguide 134 to the optical waveguide device 131 is made incident on



the output optical waveguide 135 by a deep angle exceeding the effective opening of the output optical waveguide 135, and optical connection of a cross talk component for the output optical waveguide 135 is suppressed. Thus, only optical connection efficiency for the non-waveguided beam is selectively and remarkably effectively suppressed while suppressing the deterioration of connection efficiency for a signal beam as much as possible.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.07.1998

[Date of sending the examiner's decision of

18.09.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3479220

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[Date of registration] 03.10.2003
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-19345 (P2000-19345A)

(43)公開日 平成12年1月21日(2000.1.21)

(51) Int.Cl. ⁷		識別配号	FΙ		テーマコード(参考)
G02B	6/30		G 0 2 B	6/30	2H036
	6/36	•	•	6/36	2H037
	6/42			6/42	

審査請求 有 請求項の数12 OL (全 12 頁)

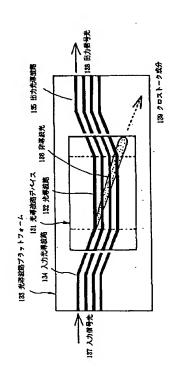
(21)出願番号	特顧平10-188374	(71) 出顧人 000004237 日本電気株式会社
(22)出顧日	平成10年7月3日(1998.7.3)	東京都港区芝五丁目7番1号
		(72)発明者 加藤 友章
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
		式会社内
		(74)代理人 100081433
		弁理士 鈴木 章夫
		Fターム(参考) 2H036 AA01 CA03 GA36
		2H037 AA01 BA35 CA04 CA34 DA04
		DA12

(54) 【発明の名称】 光集積モジュール

(57)【要約】

【課題】 ハイブリッド光集積では本質的に不可避な光 導波路不連続で発生する非導波光が光スイッチング性能 に及ぼす影響を解消することを可能にした光集積モジュ ールを提供する。

【解決手段】 光導波路デバイス131の光導波路132の入出射両端面の斜め光導波路部分が光導波路ブラットフォーム133の長手方向の直線に対して同じ側に向かって曲がって形成されており、また光導波路ブラットフォーム133の入力光導波路134と出力光導波路135も光導波路デバイス131の光導波路132の曲げに対応して同じ方向に向けて曲がって形成される。入力光導波路134から光導波路デバイス131へ導波される際に生じる非導波光は出力光導波路135に入射するたとになり、出力光導波路135に対するクロストーク成分の光結合が抑制される。その結果、信号光に対する光結合効率劣化を極力小さく抑えたまま、非導波光に対する光結合効率のみを選択的かつ極めて効果的に抑制することが可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力光導波路と出力光導波路がそれぞれ を光 形成された光導波路ブラットフォームと、前記入力光導 波路と出力光導波路の間の前記光導波路ブラットフォーム上に搭載され、かつ前記入力光導波路と出力光導波路 に光結合される光導波路デバイスとを備える光集積モジュールにおいて、前記入力光導波路と出力光導波路、及 波路 びこれらの光導波路に光結合される前記光導波路デバイスの光導波路とが、これらの光結合領域において前記光 導波路ブラットフォームの光導波方向に向けられた直線 10 ル。に対してそれぞれ同一側に曲げ形成されていることを特 徹とする光集積モジュール。 光導

【請求項2】 入力光導波路と出力光導波路がそれぞれ 長辺方向に向けて形成された長方形をした光導波路プラ ットフォームと、前記入力光導波路と出力光導波路の間 の前記光導波路ブラットフォーム上に搭載され、かつ前 記入力光導波路と出力光導波路に光結合される光導波路 デバイスとを備える光集積モジュールにおいて、前記入 力光導波路と戦記光導波路デバイス間、及び前記出力光 導波路と前記光導波路デバイス間にはそれぞれある有限 20 の空隙ができる位置関係に前記入力光導波路、出力光導 波路及び光導波路デバイスが配置されてこれらの間に光 導波路の不連続な部分が形成されており、かつ前記入力 光導波路、光導波路デバイス及び出力光導波路がいずれ も導波する信号光の放射が十分無視できる程度の緩やか な曲率で曲がっている部分をそれぞれ備え、かつ前記入 力光導波路と出力光導波路、及びこれらの光導波路に光 結合される前記光導波路デバイスの光導波路のそれぞれ が前記光導波路不連続の近傍において前記光導波路ブラ ットフォームの長手方向の直線に対して同一方向に曲げ られている斜め端面構造を備えることを特徴とする光集 積モジュール。

【請求項3】 前記光導波路デバイスは光入出射端面の うち少なくとも一方に低反射膜を備えることを特徴とす る請求項2に記載の光集積モジュール。

【請求項4】 前記光導波路デバイスはスポットサイズ 変換機構を備えることを特徴とする請求項2又は3に記 載の光集積モジュール。

【請求項5】 前記光導波路デバイスは光入出射端面近 傍に窓端面構造を備えることを特徴とする請求項2ない し4のいずれかに記載の光集積モジュール。

【請求項6】 前記光導波路デバイスは、導波する信号 光に対して電流注入による光増幅機能と電流非注入時の 光吸収機能とを実現する半導体光増幅器であることを特 徴とする請求項2ないし5のいずれかに記載の光集積モ ジュール。

【請求項7】 前記有限の空隙の部分が誘電体物質で満たされていることを特徴とする請求項2ないし6のいずれかに記載の光集積モジュール。

【請求項8】 前記光導波路プラットフォームは光ファ 50 無視できない。このため、複数の光素子を1枚の基板に

イバを入力光導波路および出力光導波路に対して信号光 を光結合させるための光ファイバ位置合わせガイドを備 えていることを特徴とする請求項2ないし7のいずれか に記載の光集積モジュール。

【請求項9】 前記光導波路デバイスは同一基板上に複数アレイ状に形成され、前記入力光導波路及び出力光導波路は同一の光導波路ブラットフォーム上に前記光導波路デバイスの光導波路に対応してアレイ状に形成されていることを特徴とする請求項8に記載の光集積モジュール

【請求項10】 前記入力光導波路、出力光導波路及び 光導波路デバイスは伝搬する信号光に対して偏光無依存 の特性を有することを特徴とする請求項9に記載の光集 積モジュール。

【請求項11】 前記入力光導波路及び出力光導波路は、同一のガラス基板又は同一のシリコン基板に形成された石英系光導波路又はポリマ光導波路、或いは同一のシリコン基板に形成されたシリコン・ゲルマニウム光導波路であるととを特徴とする請求項8ないし10のいずれかに記載の光集積モジュール。

【請求項12】 前記入力光導波路は光分波器を備え、前記出力光導波路は光合波器を備えることを特徴とする 請求項9ないし11に記載の光集積モジュール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野]本発明は、ハイブリッド光集 積技術を用いて作られた光集積モジュールに関し、特に 入力光導波路と出力光導波路の間に光導波路デバイスを 配置した構成の光集積モジュールに関する。

30 [0002]

【従来の技術】低速な電話中心のサービスから広帯域デ ィジタルマルチメディアサービスへと通信需要が移行す るにつれて、これらの通信サービス全般を効率よく多重 化するための高速かつ高スループットの光ATM交換 機、及びその中枢となる高速かつ拡張性に優れた光スイ ッチの開発が望まれている。中でも、1入力1出力の高 速光ゲート素子と光合分波素子とを組み合わせて構成し た分配選択型光スイッチは、制御が容易なことからこう した用途への応用が検討されている。このような光スイ ッチ網を実現するためには、スケーラビリティを満足す るための優れたクロストーク抑制性能、高速スイッチン グ性能、そして高速化に適したシンプルな制御方式が求 められる。このため、この高速光ゲートとしては40 d B~70dB程度の極めて高いオン/オフ性能および光 合分波器の損失補償が可能で、かつナノ秒(nsec) オーダの高速応答が期待できる半導体光増幅器(SO A)を用いた光ゲート素子(SOAG)が注目を浴びて いる。また、こうした光素子を多数使用するシステムで は、これらがシステム全体に占めるコスト、実装負荷は

モノリシック集積してある特定の機能を実現する光集積 回路(Photonic IC:PIC)や、光素子を駆動する ための周辺電子回路素子等を一体化して集積化する光・ 電気集積モジュールへの期待も高まっている。特に、光 導波路ブラットフォーム上に半導体光素子を実装したハ イブリッド光集積モジュールは、その生産性などの点か ら、最も実用に近い光集積技術として期待されている。 【0003】図10はその一例を示す平面構成図であ り、入力光導波路104、出力光導波路105を形成し た光導波路ブラットフォーム103に、前記各光導波路 104.105につながる光導波路102を有するSO AG等の光導波路デバイス101が搭載されている。と のハイブリッド光集積素子では、入力光導波路104に 入射される入力信号光107は、入力光導波路104を 導波されて光導波路デバイス101に入力され、光導波 路102を導波された後に出力光導波路105を導波さ れ、芯信号光108として出力される。

【0004】とうしたハイブリッド光集積技術を応用し て前述のSOAGを搭載した光集積モジュールを構成す る場合、入力光導波路104と光導波路デバイス101 の光導波路102との間、あるいは光導波路102と出 力光導波路105との間のように、比較的大きな光導波 路不連続での結合損失や光合分波器の分岐損失を補償す るためにSOAG自身には大きな信号光利得が求められ る。このため、SOAGには残留端面反射を極力抑制す る工夫が必要となり、そのために、光導波路を光入出射 端面の近傍でとの端面に対して斜めに曲げる斜め端面構 造や、またあるいは活性層を端面の直前で途切れさせる 窓構造などが提案されている。例えば、図11では、入 力信号光117の入射方向及び出力信号光118の出射 方向に対して、入力光導波路114及び出力光導波路1 15を所要の角度で傾斜させ、かつこれに追従して光導 波路デバイス111に設けられる光導波路112の少な くとも前記入力光導波路114、出力光導波路115と 連結する部分を同じ角度に傾斜させた構成がとられてい

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら図10,図11に示したハイブリッド光集積モジュールでは、入力光導波路104,114を導波されて光導波路デバイス101,111に入射される信号光は、入力光導波路と光導波デバイスとの間での比較的大きな光導波路不連続においてその大半が光結合に寄与しない非導波光成分となってしまう。この非導波光成分は、光出射側の光導波デバイス101,111と出力光導波路105,115との光導波路不連続の領域において再度結合してれが光ゲート素子モジュールの信号光に対する総合的なオン/オフ性能を著しく劣化させる。すなわち、光導波デバイス101,111の光入射側での非導波光の大半はそのまま直進され、光導波路デバイス101,1

11の基板中をビーム状に徐々に発散しながら反対側の出射側光導波路端面へと達する。このため、その近傍に存在している出力光導波路105,115へと非導波光がある一定の割合で結合してしまう。この現象は、光集積モジュールの光学的特性、特にSOAG等の光ゲート素子モジュールにおいて信号光のオン/オフ特性を劣化させる原因となる。このようなオン/オフは信号光の干渉性のビート雑音を招き、光モジュールの特性を著しく損ねることになる。

【0006】このような問題は、特にアレイ状の光導波路デバイスの場合には、非導波光の出射位置が他チャンネルの出射光導波路に極めて近くなることも構造的に起こり得る。例えば、図12に示すように、出力光導波路125の斜め端面が入力光導波路124の斜め端面に対して平行に形成されている場合、実際には製造上の都合から点対称で作られているものがほとんどであるため、結果として入力光導波路124と光導波路デバイス121との間での非導波光の伝搬軸は出力光導波路125に対して一番結合しやすい角度と一致してしまうことになる。これがチャンネル間クロストーク抑圧特性の著しい劣化を招くことになる。

【0007】 とういった非導波光の漏れを抑制するためには、非導波光そのものの発生を抑制するべく結合損失を向上させる対策がまず必要である。しかしながら、ハイブリッド光集積モジュールにおける結合損失をゼロにする事は本質的に不可能であり、むしろ非導波光成分を可能な限り結合させないための新たな工夫こそがより重要となってくる。しかしながら、こうした非導波光成分を効果的に取り除くための方法として実用に耐えうるものは未だ実現されていないのが実情である。

【0008】本発明の目的は、ハイブリッド光集積では本質的に不可避な光導波路不連続で発生する非導波光が光スイッチング性能に及ぼす影響を解消することを可能にした光集積モジューニを提供することである。

[0009]

【発明を解決するための手段】本発明は、図1にその基本構成を示すように、入力光導波路134と出力光導波路135がそれぞれ形成された光導波路ブラットフォーム133と、前記入力光導波路134と出力光導波路135の間の前記光導波路ブラットフォーム131上に搭載され、かつ前記入力光導波路134と出力光導波路135に光結合される光導波路デバイス131とを備える光集積モジュールにおいて、前記入力光導波路134と出力光導波路135、及びこれらの光導波路に光結合される前記光導波路デバイス131の光導波路で到ったフォーム133の光導波方向に向けられた直線に対してそれぞれ同一側に向けて曲げられていることを特徴としている。より具体的には、前記入力光導波路134と前記光導波路デバイス131間、及び前記出力光導波路1

30

35と前記光導波路デバイス131間にはそれぞれある 有限の空隙ができる位置関係に前記入力光導波路13 4、出力光導波路135及び光導波路デバイス131が 配置されてとれらの間に光導波路の不連続な部分が形成 されており、かつ前記入力光導波路134、光導波路デ バイス131の光導波路132及び出力光導波路135 がいずれも導波する信号光の放射が十分無視できる程度 の緩やかな曲率で曲がっている部分をそれぞれ備え、か つ前記入力光導波路134と出力光導波路135、及び 光導波路132のそれぞれが前記光導波路不連続の近傍 において前記光導波路プラットフォーム133の長手方 向の直線に対して同一方向に曲げられている斜め端面構 造を備えることを特徴としている。

【0010】本発明による光集積モジュールでは、光導 波路デバイス131の入出射両端面の光導波路132が 光導波路プラットフォーム133の長手方向の直線に対 して同じ側に向かって曲がって形成されており、また光 導波路プラットフォーム133の入力光導波路134と 出力光導波路135も前記光導波路132の曲げに対し て同じ方向に向けて曲がって形成されていることによ り、出力光導波路135の長手軸の方向は、入力光導波 路134と光導波デバイス131との間に生じる入力信 号光137のうちの非導波光の導波軸には一致せず、非 導波光は出力光導波路135に対して斜め光導波路の設 定角のほぼ2倍という深い角度で交差する。 このため、 非導波光は出力光導波路135の有効開口を超える深い 角度で出力光導波路135へと入射することになり、ク ロストーク成分139が出力光導波路135に導波する ことが抑制される。その結果、信号光に対する結合効率 劣化を極力小さく抑えたまま、非導波光に対する光結合 効率のみを選択的かつ極めて効果的に抑制することが可 能となる。

[0011]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態を図面を 参照して説明する。図2は本発明の第1の実施形態の平 面構成図であり、その光入出射端面に少なくとも斜め導 波路端面構造を備える光導波路デバイス201を光導波 路ブラットフォーム210上に搭載したハイブリッド光 集積モジュールにおいて、光導波路ブラットフォーム2 10上の入力光導波路211と光導波路デバイス201 の光入力端面との間にできる光導波路不連続によって発 生した非導波光成分が、反対側の出力光導波路212へ と結合してクロストーク成分となることを抑制するため の構成を備えている。

【0012】図3は、光モジュール化の対象である前記 光導波路デバイス201の平面構成図である。前記光導 波路デバイス201は、基板202の上に形成された直 線状の光導波領域203と、この光導波路領域203の 長手軸に対して互いに同じ側に向けて前記基板202に 水平な面内である角度 θ 1 で曲げられている斜め光導波 50

路領域204及び205と、前記直線状の光導波領域2 03と前記斜め光導波路領域204,205とを滑らか に接続しかつ放射の影響が無視できる程度に適当な曲率 の曲線光導波路からなる曲がり光導波路領域206、2 07とから成る。

[0013]図4は、前記該光導波路デバイス201を 搭載する前記光導波路プラットフォーム210を示して いる。前記光導波路プラットフォーム210の上には、 前記光導波路デバイス201に対して信号光を光入出射 結合しなおかつ前記光導波路デバイス201とは異なる 材料から作られている入力光導波路211及び出力光導 波路212が形成されている。とれらの入力光導波路2 11及び該出力光導波路212は、それぞれ前記光導波 路デバイス201と信号光を光入出射結合する光導波路 端面213、214に対して角度 02だけ傾いている斜 め光導波路領域215,216と、直線状の光導波路領 域217,218、及び前記斜め光導波路領域215, 216と前記直線状の光導波路領域217,218とを それぞれ滑らかに接続しかつ放射の影響が無視できる程 20 度に適当な曲率の曲線光導波路からなる曲がり光導波路 領域2 1 9 , 2 2 0 とを有する。なお、前記角度 θ 2は、前記斜め光導波路204,205の等価屈折率n1 と、前記斜め光導波路215,216の等価屈折率n2 と、前記角度 81 に基づいてスネルの法則を用いて決定 される。なお、前記直線状の光導波路領域217,21 8は、前記光導波路プラットフォーム210の端面22 1.222まで伸びている。また、前記光導波路デバイ ス201は、これと前記光導波路端面213,214と の間に有限の空隙を設けて前記光導波路ブラットフォー ム210の上に配置されている。

【0014】次に、図2~4に示した第1の実施形態の 光集積モジュールの動作について説明する。まず、との 光集積モジュールにおける基本的な信号光の伝搬経路に ついて説明する。端面221から入力光導波路211に 入射された信号光は、直線状の光導波路領域217から 曲がり光導波路領域219と斜め光導波路領域215と を介して光導波路端面213に達する。 とこから有限の 空隙を介して光導波路デバイス201へと結合した信号 光は、斜め光導波路領域202から曲がり光導波路領域 206、直線状の光導波路領域203、曲がり光導波路 領域207を介して斜め光導波路領域205に達する。 また、ことから出力光導波路212へは、入射側と同様 に有限の空隙を介して光導波路デバイス201から光導 波路端面214、斜め光導波路領域216、曲がり光導 波路領域220、直線状の光導波路領域218を介して 端面222から出射される。ここで、光導波路デバイス 201の両端に設けられた斜め光導波路領域204,2 07は、端面208、209における実効的な残留端面 反射を効果的に低減する役割を果たす。とれは、光導波 路デバイス201内部における信号光のファブリ・ペロ

S

ー(Fabty-Perot)共振を抑制するうえで効果的である。 とうした対策は、半導体光増幅器のように光導波路 デバイス自身が利得を持つような場合には特に重要である。

【0015】一方、入力光導波路211と光導波路デバ イス201との間の光導波路不連続においてこの光導波 路デバイス201へと結合しきれなかった信号光成分の 振る舞いについて説明する。光導波路デバイス201へ と結合しきれなかった信号光の大半は、ほぼ斜め光導波 路領域202の長手軸の方向に向かって光導波路デバイ ス201の基板202の中をビーム状に徐々に発散する 非導波光として、反対側の出射側光導波路端面209へ と達する。このとき、この実施形態の光集積モジュール では、光導波路デバイス201の斜め光導波路領域20 4,205は直線状の光導波路203の長手軸方向に対 して共に同じ側に向かって曲げられている。とのため、 非導波光が出射側端面209に達する近傍には出射側の 斜め光導波路が無く、その結果出射側の斜め光光導波路 212の端面近傍における非導波光の振幅は信号光のそ れに対して著しく減衰する。さらに、非導波光の発散し て行く軌跡は出射側の斜め光導波路の長手軸方向からは 大きく外れることから、角度 θ 1, θ 2等を始めとする 構造パラメータを適当に設計することにより、この非導 波光が出力光導波路へと結合する割合は信号光のそれに 比べて数桁も小さくすることが可能になる。このよう に、非導波光に対する光結合効率のみを選択的かつにが 極めて抑制する構造を提供することが可能になる。

【0016】図5は本発明をアレイ状の半導体光増幅器 のハイブリッド光集積モジュールに適用した第2の実施 形態の平面構成図であり、石英系光導波路Siプラット フォーム320に4チャンネル半導体光増幅器アレイ3 01と光ファイバ336、337を搭載した構成とされ ている。図6は前記4チャンネル半導体光増幅器アレイ 301の平面構成図であり、前記半導体光増幅器アレイ 301は、4チャンネルの半導体光増幅器が250ミク ロン間隔で配置されている構造を持つ。各半導体光増幅 器は、(001)n-InP基板302上に形成された 波長組成1.55μmのアンドープ-InGaAsPバ ルク活性層をp-InPクラッド層で埋め込んだ構造を 有する。1.55μm帯の信号光に対して単一モード光 40 導波路となっており、また電流注入によって前記信号光 に対する光増幅作用を有している。また、信号光に対す る偏光依存性を低減させるために、前記活性層の断面の アスペクト比がほぼ1:1になるよう、高さを0.3μ Μ、幅を0.3μmに設定している。

【0017】 CCで、素子長は1000μmであり、と 332が露出している光素子搭載領域334が長さ1. のうち前記活性層が前記nーInP基板302の[11 02mmにわたって形成されている。また入力光導波路0]方向に対して平行な活性層直線領域304の長さは 322と出力光導波路323とがこの光素子搭載領域3350μm、その両端に放射損失が無視できる程度に曲 34に面するSi基板321に垂直な光導波路端面32率半径4mmで活性層がn-InP基板302に水平な 50 4.325は、ダイシングブレードで切削することによ

面内で緩やかに曲げられている活性層曲線領域305, 306が100µm、さらにこれら該活性層曲線領域3 05,306に滑らかに接続しかつ該n-InP基板3 02の[110]方向に対して同じ方向に7°だけ傾い た斜め光導波路領域307,308が200 µmであ る。なお、との斜め光導波路領域307,308は、前 記活性層曲線領域305,306から端面309,31 Oに向かって長さ150μmにわたり活性層厚をもとの 厚さの1/3にまで徐々に薄くしたスポットサイズ変換 領域311,312を有する。また信号光の入出射端面 309, 310から素子内部に向かって25 µmにわた り活性層を設けない窓領域313、314を有する。と れらは、すべて選択MOVPE成長によって作製されて いる。また、素子の両端面には信号光に対する反射率が 0.1%の低反射膜315,316が形成されている。 【0018】図7は前記半導体光増幅器301を搭載す る石英系光導波路プラットフォーム320の平面構成図 である。前記光導波路プラットフォーム320には、S i 基板321上に常圧CVDを用いて成膜された石英系 の入力光導波路322が8本および出力光導波路323 が8本、それぞれ各4本ずつアレイ状に2軸対称に形成 されている。とれら入力光導波路322および出力光導 波路323は、Geドーピングされた断面が6μm角の コアをそれぞれ厚さ10μmの上下クラッド層で埋め込 んだ構造を有し、1.55μmの信号光に対して単一モ ード光導波路となっている。前記入力光導波路322及 び出力光導波路323は、それぞれ前記半導体光増幅器 301に対して信号光を効率よく入出射光結合させるた め、光導波路端面324、325に対して約15°だけ Si基板321に平行な面内で曲げられた斜め光導波路 領域326、327と、直線状の光導波路領域328, 329と、前記斜め光導波路領域326,327と直線 状の光導波路領域328、329とをそれぞれ滑らかに 接続しかつ放射の影響が無視できる程度に曲率半径10 mmで緩やかに曲げられている曲がり光導波路領域33 0,331とを有する。

【0019】また、前記Si基板321上には、上記の半導体光増幅器301を高い位置合わせ精度でセルフアライン実装しかつ各チャンネルに独立に駆動電流を注入するため、予めスパッタリング成膜されたWSi層および光導波路形成後の電極成膜プロセスを併用して、電気配線パターン332とはんだバンブパッド333とが形成されている。また、前記入力光導波路322と出力光導波路323との間に上記の半導体光増幅器301を実装するため、Si基板321ないしは電極配線パターン332が露出している光素子搭載領域334が長さ1.02mmにわたって形成されている。また入力光導波路322と出力光導波路321に垂直な光導波路端面32

ている。

り形成されている。

【0020】さらに、前記光導波路ブラットフォーム3 20の両端にはこれら入力光導波路322および出力光 導波路323のそれぞれに信号光を入出射させるための 光ファイバを高い位置精度でパッシブ実装するため、S i 基板321上に入力側8個、出力側に8個、合計16 個の光ファイバガイド338、339が長さ1mmにわ たって形成されている。との光ファイバガイド338、 339は、Si基板321に対するわずかな方位ずれが 生じても位置合わせ精度を損なわないよう、断面がV字 10 型のSi溝を光ファイバの長手軸方向にブロック状に分 割した構造を有する。

【0021】そして、前記素子搭載領域334に、2つ の前記した4チャンネル半導体光増幅器アレイ301が 前記光導波路端面324,325との間に幅10μmの 空隙を設けてAuSnはんだを用いて軸対称に実装され ている。また、これら合計16個の光ファイバガイドに 沿って、合計16本の単一モード光ファイバ336,3 37がパッシブ実装されている。

【0022】との半導体光増幅器のハイブリッド光集積 20 モジュールでは、入力光導波路322および出力光導波 路323と半導体光増幅器アレイ301との間における 光結合損失は共に4.5dB、同様に入力光導波路32 2および出力光導波路323と単一モード光ファイバ3 36.337との光結合損失は共に0.3dBであっ た。モジュール温度25℃において、8本の入力光ファ イバ336それぞれに波長1.55 µm、パワー0dB mの信号光を入力し、それぞれの入力光ファイバ336 に対応する半導体光増幅器のチャンネルに20mAの順 方向電流を注入したととろ、これに対応する出力側の光 ファイバ337から取り出された信号光の利得が0dB となった。また、40mAの電流注入により、10dB の信号光利得が各チャンネルについて得られた。また、 各チャンネルともに電流非注入時には信号光が60dB の減衰を受けて出力された。注入電流範囲が0~40 m Aの場合、出力信号光のオンオフ比として70dBが各 チャンネルについて得られた。また、あるチャンネルに 上記の信号光を入力し、これと対応しないチャンネルか らの出力信号光を測定したところ、80dB以上の減衰 を受けて出力されていることがわかった。これらの結果 は、信号光の干渉性クロストークを抑圧するうえで十分 な値である。さらに、半導体光増幅器アレイ301の各 チャンネルを振幅0~40mA、立ち上がり/立ち下が り時間が各1nsecの駆動電流で高速駆動したところ、こ の駆動電流波形に追従する高速な光ゲート動作を得た。 【0023】図8は、本発明をアレイ状の石英系光導波 路と波長合波器と波長分波器とを形成した光導波路Si プラットフォーム420上にアレイ状の半導体光増幅器 301をハイブリッド光集積した光ファイバ集積8チャ

態の平面構成図である。前記半導体光増幅器アレイ30 1は、前記第2の実施形態で使用したものとまったく同 一のものであるので、その詳細な説明は省略する。 【0024】図9は前記石英系光導波路プラットフォー ム420の平面構成図である。該光導波路ブラットフォ ーム420は、第2の実施形態と同様に構成された光導 波路ブラットフォーム上に1:8波長分波器440と 8:1波長合波器441とを作り込んだものである。と れらは、波長1.55 μm帯の信号光をそれぞれ8:1 波長分離および1:8波長多重する役割をはたす。な お、これらによって波長合分波される信号光の隣接波長 間隔は約0.8nm(光周波数で100GHz)であ り、両者の波長通過域は一致している。なお、前記光導 波路プラットフォーム420のこれら以外の構造は第2 の実施形態と同一であるため、その詳細な説明は省略す る。ただし、前記波長分波器440及び波長合波器44 1に結合される光ファイバはそれぞれ1本であるので、 光ファイバガイド438,439は各1つだけ設けられ

【0025】そして、前記したように、前記光導波路プ ラットフォームの素子搭載領域434に、2つの4チャ ンネル半導体光増幅器アレイ301が前記光導波路端面 424, 425との間に幅10μmの空隙を設けてAu Snはんだを用いて軸対称に実装されている。また、光 ファイバガイド438、439に沿って、2本の単一モ ード光ファイバ436、437がパッシブ実装されてい る。

【0026】との光ファイバ集積8チャンネル波長セレ クタモジュールでは、モジュール温度25℃において、 入力側の光ファイバ436に波長合波器と波長合波器の 通過帯域に一致しかつそれぞれ異なる8波信号光を波長 多重して入力し、それぞれの信号光波長に対応する半導 体光増幅器のチャンネルのうち特定の1つのチャンネル にのみ30mAの順方向電流を注入したところ、出力側 の光ファイバ437からはこのチャンネルを通過するこ とができた波長の信号光のみが出力された。またその時 の信号光利得は0dBであった。また、50mAの電流 注入により、5dBの信号光利得が得られた。また、各 チャンネルともに電流非注入時には信号光が70dBの 減衰を受けて出力された。注入電流範囲が0~50mA の場合、出力信号光のオンオフ比として75dBが各波 長チャンネルについて得られた。また、それぞれ異なる 8波信号光を波長多重して入力し、同様に特定の1つの チャンネルにのみ30mAの順方向電流を注入したとこ ろ、これと対応しない波長チャンネルの信号光が80 d B以上の減衰を受けて出力されていることがわかった。 とれらの結果は、信号光の干渉性クロストークを抑圧す るうえで十分な値である。また、それぞれ異なる8波信 号光を波長多重して入力し、同様に特定の1つのチャン ンネル波長セレクタモジュールに適用した第3の実施形 50 ネルにのみ振幅0~40mA、立ち上がり/立ち下がり

時間が各1 n s e c の駆動電流で高速駆動したところ、 この駆動電流波形に追従して対応する1波長のみを高速 に選択する波長セレクタとして動作した。

【0027】なお、本発明のハイブリッド光集積モジュールは、前記した構成に限られるものではなく、入力光 導波路と出力導波路との間に光導波デバイスを配設する構成を備える光集積回路モジュールであれば、前記入力 光導波路と出力導波路の構成が本発明の基本構成を備えるものであれば、種々の光集積モジュールに適用するととが可能である。また、光導波路で構成されるチャンネル数も前記した各実施形態の構成に限られるものでないことは言うまでもない。

【0028】また、本発明においては、次のような実施 形態も可能である。すなわち、光導波路デバイスがこと を伝搬する信号光に対して電圧印加によって光吸収機能 を実現する電界吸収型半導体光変調器である。また、光 導波路デバイスが電流注入機構ないしは電圧印加機構を 少なくとも1つ以上備える。

【0029】また、光導波路ブラットフォームは、はんだバンブを構成する電気配線以外にも何らかの電気配線を備えている。光導波路ブラットフォーム上には光導波路デバイスの駆動等を目的とした電気素子や終端抵抗等を備えている。光導波路ブラットフォーム上の入力光導波路および出力光導波路に対して光ファイバを介して信号光を光結合させさらにこの光ファイバをこの光導波路ブラットフォームに対して脱着させるためのレセプタクル機構を合わせ備える。

【0030】さらに、光導波路ブラットフォームにおける入力光導波路あるいは出力光導波路はこれらを伝搬する信号光を入力光導波路側から出力光導波路側に向かって一方向にのみ伝搬させる光アイソレータとしての機能を備える。入力光導波路あるいは出力光導波路は出方的性結合器を備える。入力光導波路あるいは出力光導波路は光方向性結合器を備える。入力光導波路あるいは出力光導波路はとこを導波する信号光の位相調節を行うための機構を備える。入力光導波路又は出力光導波路には、導波する信号光を増幅するための希土類元素が含まれている。入力光導波路あるいは出力光導波路のアレイ光導波路回折格子を備える。

【0031】さらに、入力光導波路と出力光導波路と光 導波路デバイスのいずれかはこれらを導波する信号光の パワーや偏光を検出や監視あるいは制御する等の機能を 備える。入力光導波路や出力光導波路や光導波路デバイ ス等、光導波路ブラットフォーム上に形成ないしは実装 されているものの温度を監視する手段あるいは温度調節 をする手段を備える。

[0032]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、光導波デバイスの光導波路の信号光入出射端面での曲げ方向と、

光導波路プラットフォームに形成された入力光導波路と 出力光導波路での曲げ方向が、いずれも光導波路ブラッ トフォームの長手軸方向に対して同じ側に向けて曲げら れているため、非導波光が出力光導波路に向かわず、光 導波路デバイスの基板外部に向かって放射されてしまう ことになり、これにより非導波光によるオンオフ比劣化 を極力抑えたハイブリッド光集積モジュールを得ること が可能となる。また、同時に、アレイ状の光集積モジュ ールを構成した場合に、非導波光が他チャンネルへと漏 10 れ込んでチャンネル間クロストーク成分となることを極 力抑える構造を得ることができる。さらに、光導波路デ バイス内部での共振が効果的に抑制されるため、光導波 路デバイス内部の信号光利得を大きくでき、特に信号光 利得を有する半導体光増幅器のような光導波路デバイス でも光導波路ブラットフォーム上に搭載して光集積回路 モジュールを構築することが可能となる。したがって、 本発明によるハイブリッド光集積モジュールは、特に信 号光利得を有する半導体光増幅器のような光導波路デバ イスのハイブリッド光集積化に際して、高オン/オフ特 性、低チャンネル間クロストーク、高い信号光利得を同 時に満足する手段を提供し、光波ネットワーク向け光A TM交換機等に用いる光ゲート素子等の小型化、高性能 化などを実現可能にするものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光集積モジュールの基本構成を示す平 面構成図である。

【図2】本発明の第1の実施形態の光集積モジュールの 平面構成図である。

【図3】第1の実施形態における光導波路デバイスの平) 面構成図である。

【図4】第1の実施形態における光導波路プラットフォームの平面構成図である。

【図5】本発明の第2の実施形態の光集積モジュールの 平面構成図である。

【図6】第2の実施形態における光導波路デバイスの平面構成図である。

【図7】第2の実施形態における光導波路プラットフォ ームの平面構成図である。

【図8】本発明の第3の実施形態の光集積モジュールの 40 平面構成図である。

【図9】第3の実施形態における光導波路プラットフォームの平面構成図である。

【図10】従来の光集積モジュールの一例の平面構成図 である。

【図11】従来の光集積モジュールの他の例の平面構成 図である。

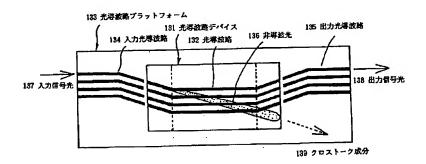
【図12】従来の光集積モジュールのさらに他の例の平面構成図である。

【符号の説明】

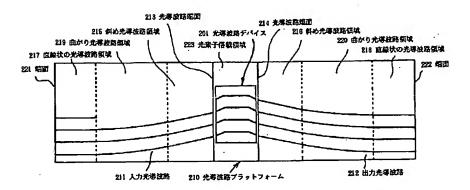
50 101, 111, 121, 131 光導波路デバイス

			(0)			140112000	
	13					14	
102.	112, 122, 132	基板	*	320	石英系光	<i>導</i> 波路ブラットフォーム	
	113, 123, 133			321	Si基板		
104.	105, 114, 115,	124, 125, 1		322	入力光導	波路	
34,135 斜め光導波路領域				323			
	116, 126, 136	非導波光				斜め光導波路領域	
	117, 127, 137			328,	329	直線状の光導波路領域	
	118, 128, 138			330,	3 3 1	曲がり光導波路領域	
	119, 129, 139			332		はパターン	
	光導波路デバイス			333,	3 3 5	はんだバンプパッド	
202			10		光素子指		
203	直線状の光導波領域					単一モード光ファイバ	
204	205 斜め光導波路領域	域				光ファイバガイド	
206,207 曲がり光導波路領域					光導波路プラットフォーム		
210 光導波路プラットフォーム				421 Si基板			
211 入力光導波路					入力光導波路		
212 出力光導波路				423 出力光導波路			
215	, 216 斜め光導波路領	域				光導波路端面	
217	, 218 直線状の光導波	路領域				斜め光導波路領域	
	, 220 曲がり光導波路					直線状の光導波路領域	
301	4 チャンネル偏光無依存	半導体光増幅器アレイ	20	430,	431	曲がり光導波路領域	
302	(001) n-InP基	板				泉パターン	
304	活性層直線領域					はんだパンプパッド	
305	,306 活性層曲線領域				光素子		
	, 308 斜め光導波路領					単一モード光ファイバ	
3 1 1	, 312 スポットサイズ	変換領域				光ファイバガイド	
	, 314 窓領域				波長分		
3 1 5	, 316 低反射膜		*	441	波長合		

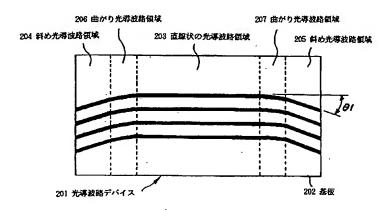
[図1]



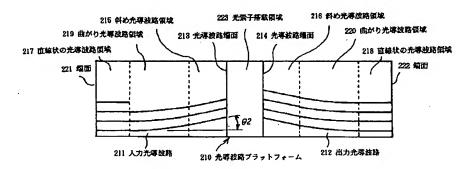
[図2]



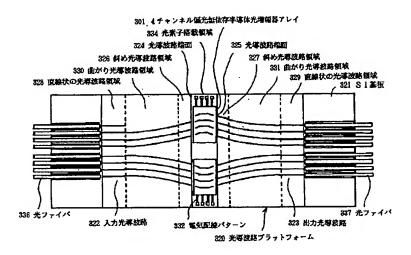
[図3]



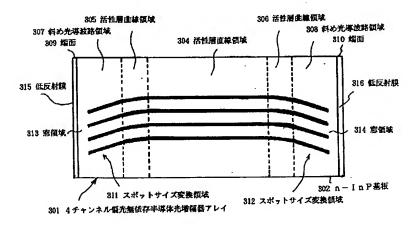
[図4]



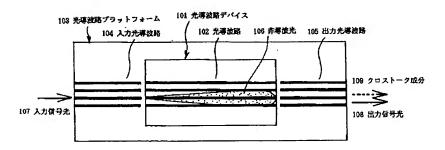
【図5】



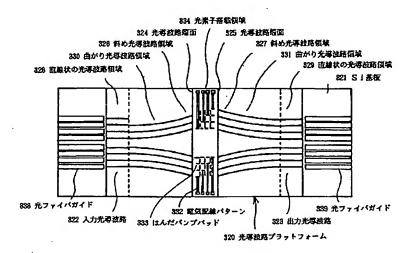
【図6】



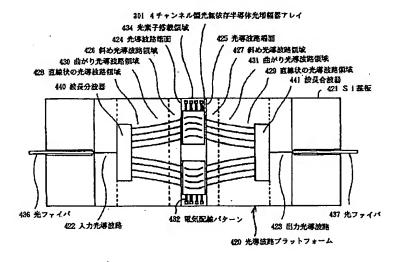
【図10】



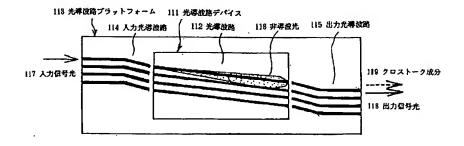
【図7】



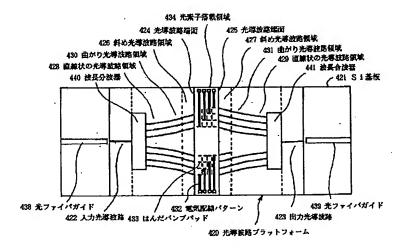
【図8】



【図11】



【図9】



【図12】

